

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 05-021579

(43)Date of publication of application : 29.01.1993

(51)Int.Cl.

H01L 21/68
H01L 21/203

(21)Application number : 03-174867

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing : 16.07.1991

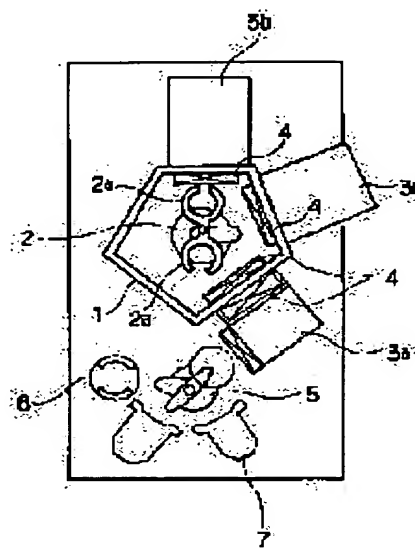
(72)Inventor : SUZUKI MASAFUMI

(54) VACUUM PROCESS EQUIPMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a vacuum process equipment capable of easily replacing and conveying wafers, with high precision without moving the wafers up and down.

CONSTITUTION: In a sheet type vacuum process equipment which can shorten replacing time of wafers by reducing the operation of a conveying equipment 2, improve the throughput capacity of the equipment, replace and convey wafers between process chambers 3b, 3c and a conveying chamber 1, and prevent generation of crosscontamination between the process chambers, when the wafers are replaced and conveyed between the conveying chamber 1 and the process chambers 3b, 3c with the conveying equipment 2, and has the conveying chamber 1 installed so as to be adjacent to the process chambers 3b, 3c via gate valves 4 and fingers which convey the wafers between the process chambers 3b, 3c and the conveying chamber 1, at least two or more fingers 2a are provided in the conveying chamber 1, and the respective fingers 2a are horizontally installed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

BEST AVAILABLE COPY

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-21579

(43)公開日 平成5年(1993)1月29日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L 21/68	A	8418-4M		
21/203	Z	8422-4M		

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全 5 頁)

(21)出願番号 特願平3-174867

(22)出願日 平成3年(1991)7月16日

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72)発明者 鈴木 雅史

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(74)代理人 弁理士 井桁 貞一

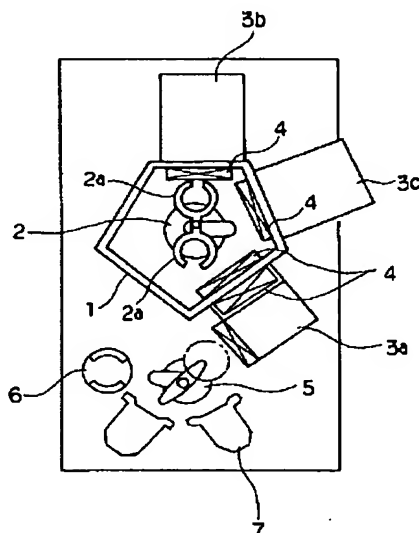
(54)【発明の名称】 真空処理装置

(57)【要約】

【目的】 本発明は、真空処理装置に関し、搬送室と処理室間でウェーハを搬送装置で入れ換え搬送する際、搬送装置の動作を少なくしてウェーハの入れ換え時間を短縮することができ、装置の処理能力を向上させることができ、しかも1個の処理室と搬送室間でウェーハを入れ換え搬送することができ、各処理室間でクロスコンタミネーションを生じないようにすることができ、更には、上下動させないで精度良く、かつ容易にウェーハを入れ替え搬送することができる真空処理装置を提供することを目的とする。

【構成】 ゲート弁4を介して処理室3b、3cと隣接して設けられた搬送室1と、該処理室3b、3cと該搬送室1間でウェーハを搬送するフィンガーを有する搬送装置2とを有する枚葉式の真空処理装置において、該搬送室1のフィンガー2aを少なくとも2個以上にし、かつ該フィンガー2a同志を水平に設けるように構成する。

本発明の一実施例に則した真空処理装置の構成を示す概略図



BEST AVAILABLE COPY